

REIVINDICACIONES

1. Un método para formar un polarizador, caracterizado porque comprende:
 - formar un patrón lineal de picos y valles en una superficie de un artículo óptico; y
 - formar alambres conductivos en el patrón lineal de picos y valles mediante deposición física de vapor de un revestimiento conductivo.
2. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa de formar un patrón lineal de picos y valles en una superficie de un artículo óptico comprende moldear por inyección el artículo óptico contra una superficie de molde que tiene el patrón lineal de picos y valles formado en este.
3. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa de formar un patrón lineal de picos y valles en una superficie de un artículo óptico comprende el moldeo por vaciado del artículo óptico contra una superficie de molde que tiene el patrón lineal de picos y valles formado en este.
4. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa de formar un patrón lineal de picos y valles en una superficie de un artículo óptico comprende maquinado del patrón lineal de picos y valles directamente en una superficie del artículo óptico.
5. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa de formar un patrón lineal de picos y valles en una superficie de un artículo óptico comprende formar el patrón lineal de picos y valles en la superficie de unos lentes ópticos terminados.
6. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa de formar un patrón lineal de picos y valles en una superficie de un artículo óptico comprende formar el patrón lineal de picos y valles en la superficie de una película.
7. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la

etapa de formar un patrón lineal de picos y valles en una superficie de un artículo óptico comprende formar un patrón lineal de picos y valles que tiene una pendiente en un intervalo de 150 hasta 300 nanómetros.

8. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa de formar un patrón lineal de picos y valles en una superficie de un artículo óptico comprende formar regiones estructuradas lineales diferentes en el artículo óptico.
9. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa de formar alambres conductivos en el patrón lineal de picos y valles mediante deposición física de vapor de un revestimiento conductivo comprende el revestimiento de una punta del patrón lineal de picos.
10. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa de formar alambres conductivos en el patrón lineal de picos y valles mediante deposición física de vapor de un revestimiento conductivo comprende el revestimiento desde un ángulo con relación a una mejor línea de ajuste a través de la superficie del artículo óptico que está entre cero y 90 grados.
11. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa de formar alambres conductivos en el patrón lineal de picos y valles mediante deposición física de vapor de un revestimiento conductivo comprende el revestimiento de un revestimiento conductivo reflectante.
12. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa de formar alambres conductivos en el patrón lineal de picos y valles mediante deposición física de vapor de un revestimiento conductivo comprende revestir un revestimiento conductivo no reflectante.
13. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque la etapa de formar alambres conductivos en el patrón lineal de picos y valles mediante deposición física de vapor de un revestimiento conductivo comprende revestir un revestimiento conductivo transparente.
14. Un método para formar un artículo oftálmico polarizado caracterizado porque comprende:
 - formar un patrón lineal de picos y valles en la superficie de un artículo oftálmico;

- revestir la superficie del artículo oftálmico con un revestimiento conductivo desde un ángulo con relación a una mejor línea de ajuste a través de la superficie del artículo oftálmico que está entre cero y 90 grados; y
- formar alambres conductivos que cruzan la superficie del artículo oftálmico a través de dicho revestimiento.

15.El método de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque la etapa de formar un patrón lineal de picos y valles en la superficie de un artículo oftálmico comprende moldear por vaciado el patrón lineal de picos y valles en la superficie del artículo oftálmico.

16.El método de conformidad con la reivindicación 14, caracterizado porque la etapa de revestir la superficie del artículo oftálmico con un revestimiento conductivo desde un ángulo con relación a una mejor línea de ajuste a través de la superficie del artículo oftálmico que está entre cero y 90 grados comprende revestir una punta de un pico del patrón lineal de picos y valles.

17.Unos Lentes oftálmicos polarizados moldeados, caracterizados porque comprenden:

- unos lentes que tienen una primera y segunda superficie;
- una serie lineal de picos y valles formados en una de dicha primera y segunda superficies de los lentes; y
- una serie de alambres conductivos formados en los picos de la serie lineal de picos y valles de los lentes.

18.Los lentes de conformidad con la reivindicación 17, caracterizados porque la serie lineal de picos y valles se moldea por vaciado en una de dicha primera y segunda superficies de los lentes.

19.Los lentes de conformidad con la reivindicación 17, caracterizados porque los alambres conductivos formados en un lado de los picos de la serie lineal de picos y valles.